電子線やX線による結晶の欠陥解析とその SiC テクノロジーへの応用(連載 その 7) 松畑洋文、山口博隆、関口隆史

# 産業技術総合研究所 物質材料研究機構

### 7. 基底面転位とショックレー型積層欠陥の構造

### ・はじめに

SiC 結晶では、巨視的に見ると1本の基底面転位のように見えていても、微視的に見ると2本の基底面部分転位に 分解していて、その2本の基底面部分転位の間にはショックレー型積層欠陥が形成されています[1-5]。SiC 結晶で はショックレー型積層欠陥のエネルギーが低いので、比較的簡単に二つの部分転位の距離が広がり積層欠陥の面積 の増大が容易に発生します[1-5]。SiC バイポーラ素子で発生するいわゆる順方向特性劣化もこのショックレー型積 層欠陥の面積の増大による現象と考えられています。この連載を含めて連載 8,9,10 で、バイポーラ素子での順方向 特性劣化の現象を引き起こす基底面転位と、バイポーラ素子を作製する前段階のエピ膜中に残存する基底面転位と の関係を示します。この関係より、順方向特性劣化を引き起こす基底面転位が、どのプロセスにより導入されたも のかを議論することが可能になると考えられます。この連載 7 では、まず 4H-SiC 結晶の基底面に存在する基底面 転位とショックレー型積層欠陥との結晶学的な関係を整理しておきます。ここで整理した内容は、後の連載その 8,9,10 での議論で使います。

### ・4H構造の基底面の積層



図 1 (a) 3C 構造での四面体の積層、(b) 2H 構造での四面体の積層、(c) 4H 構造での四面体の積層、(d) 6H 構造での 四面体の積層を示す図。

図1は3C、2H、4H、6H構造での四面体の積層の様子を示した図です。四面体の4隅にC原子、四面体中心にSi 原子を配置することとします。3C構造では、各四面体は反転されることなくそのまま ABCABC…と積層します。 2H、4Hや6Hでは四面体の左右が反転しているものが現れます。反転している四面体には 'のマークをつけてい ます。図1(c)中の破線は、基底面転位やショックレー型積層欠陥が導入される位置を示しています。基底面転位や ショックレー型積層欠陥は、C原子で構成された四面体の底面と、四面体の中心のSi原子層との間に導入されます。 以下にそれらの基底面転位が形成する転位ループの構造を整理します。





図2 b=1/3[1120]の基底面転位ループの構造。(a) 巨視的に見た時の完全転位状態の転位ループ。(b) 2 つの部分 転位に分解し、間にショックレー型積層欠陥が存在している状態の転位ループ。(c) 同じく 2 つの部分転位に分解 した状態だが、(b)で示したものとは異なる分解の状態。

図 2 は Si 面側から見た基底面転位のループの模式図を示します[5,6]。各転位の向きを時計回りに設定します。転位 がバーガース・ベクトルと直交する向きに走っている部分は刃状転位と定義されます。転位がバーガース・ベクト ルと平行あるいは反平行になっている部分をらせん転位と定義しています。それ以外の部分は、刃状成分とらせん 成分とをあわせ持つ混合転位部です。刃状成分があると転位線に沿ってダングリングボンド列が出現します。実際 の転位ではダングリングボンド自体はリコンストラクトしていると考えられていますが、ここではダングリングボ ンドを持つと表現して話しを進めます。一方で、らせん転位部にはダングリングボンド列はありません。図 2 (a) は b=1/3[1120]の完全転位の転位ループを示しています。完全転位の H→A→B→C は Si 原子がダングリングボンド を持つ Si コア転位です。A→B 部はバーガース・ベクトルと転位とが直角を成しており Si コア刃状転位部です。H →A 部、B→C 部はバーガース・ベクトルと転位とが 60 度の角度をなす 60 度 Si コア転位部です。

 $C \rightarrow D$ 部、 $G \rightarrow H$ 部は基底面転位のらせん転位部分です。 $D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$ はCコア転位です。 $\boxtimes 2(a)$ は巨視的に見た基底面完全転位のループですが、この完全転位は、微視的に見ると、ショックレー型積層欠陥をはさんで2つの部

分転位に実際には分解しています。これは、通常以下ように示されています。

## $\mathbf{b}=1/3[11\overline{2}\ 0] \rightarrow 1/3[10\overline{1}\ 0] + 1/3[01\overline{1}\ 0]$

分解の仕方には2種類あり、それらを図2(b)と2(c)に示します。図2(b)では1/3[10T0]の部分転位がループの内 側に、1/3[01T0]がループの外側に存在しています。図2(c)では逆転しています。また、図2(b)と2(c)は互いに左 右を反転させた構造になっています。図1(c)で示されているように、4H-SiCでは四面体A、Bと四面体A'C'では 左右の向きが逆になっていて、図2(b)の転位ループは、基底面転位が四面体A、Bの中のすべり面上に載っている ときに現れ、図2(c)で示されている左右が逆転している転位ループは、四面体A'C'の位置で現れます。4H-SiCの [0001]方向の積層の順番に基底面転位ループを見ていくと、図2(a)の型の転位ループが2回現れて、つぎに図2(b) の型の転位ループが2回現れるということになります。以上より、b=1/3[1120]のバーガース・ベクトルを持つ転 位ループには2種類のものがあることがわかります。4H-SiCの基底面転位には6つの方向を向く6種類のものがあ るので、基底面転位ループには12種類の異なる構造のものがあると考えられます。2H-SiCでは、図2(a)の型のも のと、図2(b)の型のものが交互に1回ずつ現れます。3C構造だと図2(a)のものかあるいは図2(b)のもの1種類の みしか現れません。

図 2(a)と 2(b)での黒線は C コアの部分転位部を示しており、青線は Si コア刃状転位部、緑線が 60 度 Si コ ア転位部、そして赤線が 30 度 Si コア転位部を表しています。後の連載その 8 で述べる順方向特性劣化や REGD 効 果では、赤線の 30 度 Si コア転位部が、転位線に垂直に動き出し積層欠陥の面積を増大させる現象として報告され ています[7]。図 2(a) の c1→d1 部では 1/3[01T 0]の部分転位転位が 1/3[11Z 0] 方向に向かって走り積層欠陥の左側 に 30 度 Si コア転位が位置しています。h1→g1 部では 1/3[10T 0] の部分転位転位が 1/3[T T 20]方向に向かって走り 積層欠陥の左側に 30 度 Si コア転位が位置しています。図 2(b) g2→h2 部では 1/3[01T 0]の部分転位が 1/3[11Z 0]方向 に向かって走り積層欠陥の左側に 30 度 Si コア転位が位置し、また d2→c2 部では 1/3[10T 0]の部分転位が 1/3[T T 20] 方向に向かって走り積層欠陥の右側に 30 度 Si コア転位が位置しています。また、図 2(a)では f1→q1 部では 1/3[10T 0] の部分転位が[2T T 0]方向に向かって走り積層欠陥の右下側に位置していて、p1→j1 部では 1/3[01T 0]の部 分転位が[2T T 0]方向に向かって走り積層欠陥の左上側に位置している。q2→f2 部では 1/3[01T 0]の部 分転位が[1Z 10]方向に向かって走り積層欠陥の左下側に 30 度 Si コア転位が位置しています。

以上、基底面転位が、部分転位に分解した時に 30 度 Si コア部分転位が、基底面転位ループのどの位置にどのよう に現れるかについて整理してみました。これらの整理した知識は、連載その 8,9,10 で利用することとします。

#### 参考文献

- 1) K. Maeda, K. Suzuki, S. Fujita, M. Ichihara, and S. Hyodo, Philos Mag. A57, 573 (1988)
- 2) X. J. Ning and P. Pirouz: J. Mat. Res., 11 (1996) 884.
- 3) X. J. Ning, N. Huvey, and P. Pirouz; J. Am. Ceram. Soc. 80 (1997) 1645.
- 4) M. H. Hong A. V. Samant and P. Pirouz: Philos Mag. 80 (2000) 919.
- 5) P. Pirouz, J. L. Demenet and M. H. Hong: Philos Mag. 81 (2001) 1207.
- 6) H. Matsuhata, H. Yamaguchi, T. Yamashita, T. Tanaka, B. Chen, T. Sekiguchi: Philos. Mag. 94 (2014) 1674.
- 7) A. Galeckas, J. Linnros, P. Pirouz: Phys. Rev. lett., 96 (2006) 025502